

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第1区分

【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公表番号】特表2008-506886(P2008-506886A)

【公表日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-009

【出願番号】特願2007-521689(P2007-521689)

【国際特許分類】

F 01 N 3/28 (2006.01)

B 01 J 33/00 (2006.01)

B 01 D 53/86 (2006.01)

【F I】

F 01 N 3/28 3 1 1 N

B 01 J 33/00 Z A B G

B 01 D 53/36 C

【手続補正書】

【提出日】平成20年7月15日(2008.7.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

汚染制御装置の内側に汚染制御要素を取り付けるのに好適な取付システムであって、

汚染制御装置で使用するのに好適な纖維材料を含み、厚さを有するマットと、

前記取付システムが前記汚染制御装置で使用された場合に、前記汚染制御要素の外周面と接触するように、前記マットの接触面に配置された無機の微粒子とを含み、

前記微粒子は、耐熱性を有し、かつ前記マットの接触面と前記汚染制御要素の外周面との間の摩擦係数を増加させることができる、取付システム。

【請求項2】

前記微粒子が、前記マット中に含まれる全内容物の少なくとも70%の含有量で、前記マットの前記表面から、前記マットをその厚さ方向で観察した場合に50%の深さまでの範囲の下部領域に含まれる、請求項1に記載の取付システム。

【請求項3】

前記マットをその厚さ方向で観察した場合に、前記微粒子が、前記マットの前記表面に向かって濃度が増加するように分散している、請求項1に記載の取付システム。

【請求項4】

前記微粒子が研磨材料からなる、請求項1～3のいずれか1項に記載の取付システム。

【請求項5】

前記微粒子が、JIS R 6001によって規定される研磨剤粒度に関して約F1, 200～約F60の範囲内の粒度を有する、請求項1～3のいずれか1項に記載の取付システム。

【請求項6】

ケーシングと、前記ケーシングの内部に配置された汚染制御要素と、請求項1～5のいずれか1項に記載の取付システムとを含む汚染制御装置であって、前記ケーシング内の所望の位置に前記汚染制御要素を保持するように前記取付システムが、前記ケーシングと前

記汚染制御要素との間に配置されている、汚染制御装置。

【請求項 7】

前記汚染制御要素が触媒担体又はフィルターエレメントである、請求項6に記載の汚染制御装置。

【請求項 8】

請求項6又は7に記載の汚染制御装置を含む、内燃機関用排気システム。